

[REDACTED]

電 車

山 手 線

手 利 降

ることを報告してきた。

[REDACTED]

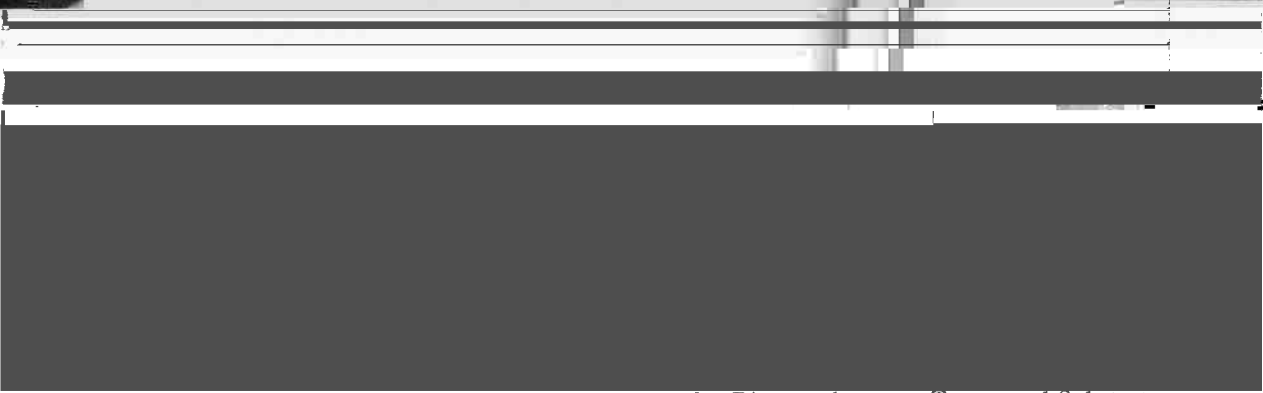


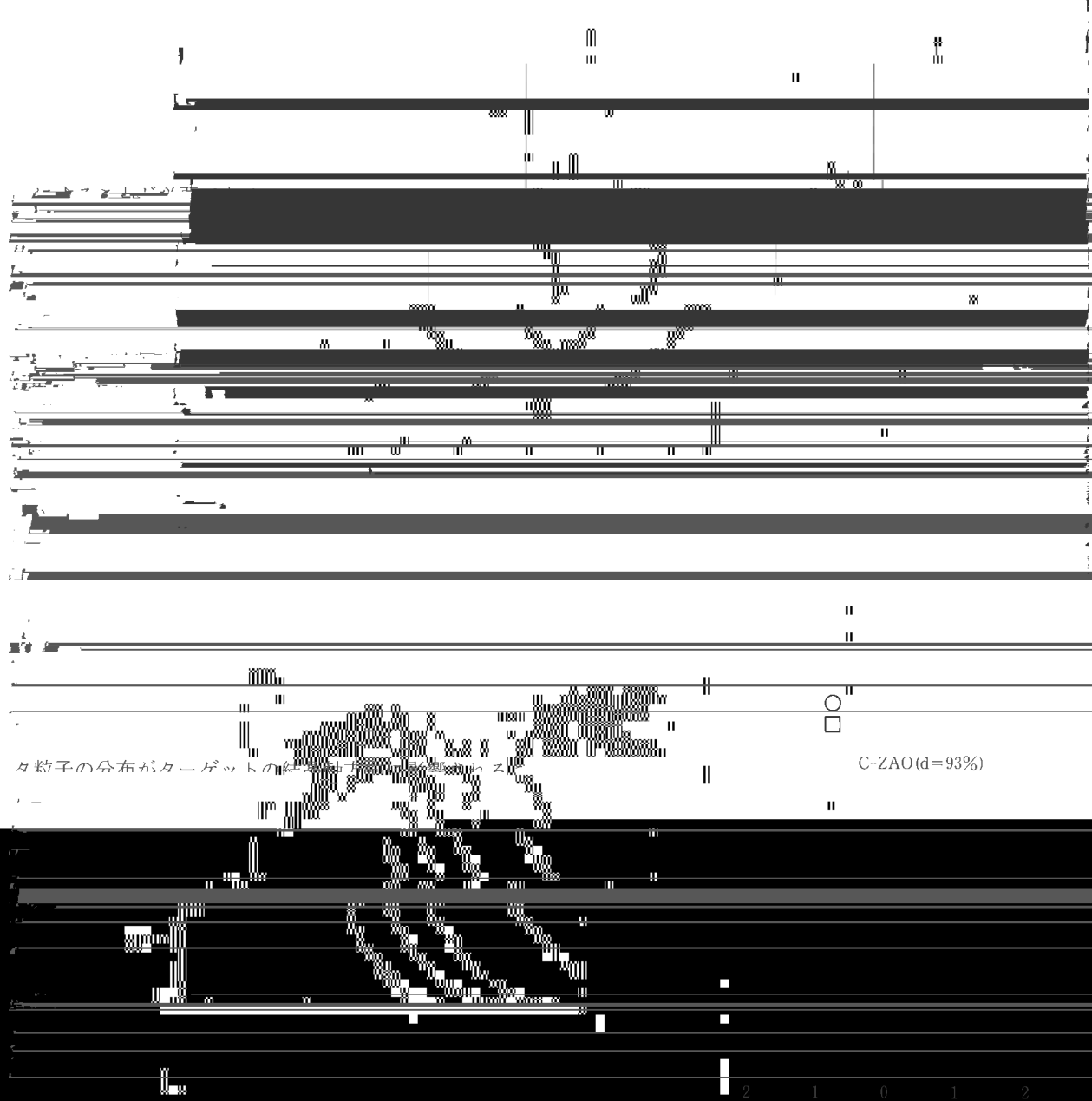
TABLE 1. Sputtering Conditions

Run	Power (W)	Pressure (mTorr)	Time (min)	Substrate Temp (°C)	Distance (cm)	Target
1	100	0.5	30	25	10	Al
2	100	0.5	30	25	10	Al
3	100	0.5	30	25	10	Al
4	100	0.5	30	25	10	Al
5	100	0.5	30	25	10	Al
6	100	0.5	30	25	10	Al
7	100	0.5	30	25	10	Al
8	100	0.5	30	25	10	Al
9	100	0.5	30	25	10	Al
10	100	0.5	30	25	10	Al
11	100	0.5	30	25	10	Al
12	100	0.5	30	25	10	Al
13	100	0.5	30	25	10	Al
14	100	0.5	30	25	10	Al
15	100	0.5	30	25	10	Al
16	100	0.5	30	25	10	Al
17	100	0.5	30	25	10	Al
18	100	0.5	30	25	10	Al
19	100	0.5	30	25	10	Al
20	100	0.5	30	25	10	Al
21	100	0.5	30	25	10	Al
22	100	0.5	30	25	10	Al
23	100	0.5	30	25	10	Al
24	100	0.5	30	25	10	Al
25	100	0.5	30	25	10	Al
26	100	0.5	30	25	10	Al
27	100	0.5	30	25	10	Al
28	100	0.5	30	25	10	Al
29	100	0.5	30	25	10	Al
30	100	0.5	30	25	10	Al
31	100	0.5	30	25	10	Al
32	100	0.5	30	25	10	Al
33	100	0.5	30	25	10	Al
34	100	0.5	30	25	10	Al
35	100	0.5	30	25	10	Al
36	100	0.5	30	25	10	Al
37	100	0.5	30	25	10	Al
38	100	0.5	30	25	10	Al
39	100	0.5	30	25	10	Al
40	100	0.5	30	25	10	Al
41	100	0.5	30	25	10	Al
42	100	0.5	30	25	10	Al
43	100	0.5	30	25	10	Al
44	100	0.5	30	25	10	Al
45	100	0.5	30	25	10	Al
46	100	0.5	30	25	10	Al
47	100	0.5	30	25	10	Al
48	100	0.5	30	25	10	Al
49	100	0.5	30	25	10	Al
50	100	0.5	30	25	10	Al

Table 1. Sputtering Conditions



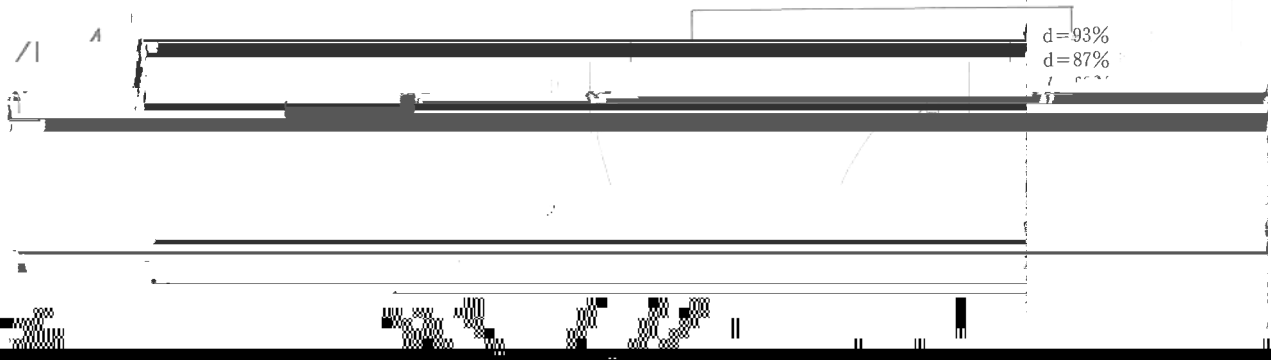
Fig. 5 Schematic Image of Sputtering Mechanisms for C-ZAO and ZAO Targets



タ粒子の分布がターゲットの粗さ因子と関係がある。

C-ZAO(d=93%)

2 1 0 1 2



INTENSITY

RESISTIVITY ( $\Omega$ )

$10^{-2}$

$10^{-3}$

POSITION OF SUBSTRATE (cm)



[REDACTED]

[REDACTED]